13

# Влияние давления кислорода на текстуру пленки магнетита, выращенного методом реактивного осаждения на поверхности SiO<sub>2</sub>/Si(001)

© В.В. Балашев<sup>1,2</sup>, В.А. Викулов<sup>1</sup>, Т.А. Писаренко<sup>1,2</sup>, В.В. Коробцов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН,

Владивосток, Россия <sup>2</sup> Школа естественных наук Дальневосточного федерального университета, Владивосток, Россия

E-mail: balashev@mail.dvo.ru

(Поступила в Редакцию 2 июня 2015 г.)

Методом реактивного осаждения Fe в атмосфере кислорода на окисленной поверхности подложки кремния Si(001) выращены пленки магнетита (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) толщиной 75 nm. Рост пленок оксида железа проводился при разных значениях давления O<sub>2</sub>. Структура пленок контролировалась в процессе их роста методом дифракции быстрых электронов на отражение. Установлено, что только в определенном диапазоне давлений O<sub>2</sub> наблюдается рост пленок магнетита с текстурой. Уменьшение давления кислорода приводит к росту пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> без текстуры, тогда как реактивное осаждение при значениях давления выше верхней границы указанного диапазона приводит к формированию кристаллитов гематита ( $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) в пленке Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

# 1. Введение

Магнетит является известным полуметаллом, обладающим высокой температурой Кюри (~ 580°С). Согласно расчетам зонной структуры [1], данный материал характеризуется полной спиновой поляризацией электронов проводимости и является перспективным с точки зрения создания спиновых приборов. В частности, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> может быть использован как инжектор спинполяризованных электронов проводимости в полупроводник в случае таких гибридных структур, как ферромагнетик/полупроводник. Поэтому огромное количество исследовательских работ было посвящено росту Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> на подложках кремния [2,3]. Однако было обнаружено, что на начальной стадии роста пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> на чистой поверхности Si образуется как силицид железа, так и аморфный оксид кремния [4]. Для того чтобы избежать образования такого нежелательного слоя, в некоторых работах были использованы различные буферные слои на границе раздела Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/Si. Также исследовался рост Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> на буферном слое SiO<sub>2</sub> [5–7].

Анализ экспериментальных данных, полученных в ряде работ, указывает на то, что рост магнетита на пленке SiO<sub>2</sub> может приводить к росту поликристаллической пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> как с преимущественной ориентацией кристаллитов (пленки с текстурой), так и без нее. Следует заметить, что текстура в пленках магнетита зависит от методики осаждения и условий роста пленок. Так, в случае импульсного лазерного распыления из источника  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> пленка магнетита может иметь как текстуру (111) [2], так и текстуру (311) [6]. В случае магнетронного распыления Fe в атмосфере Ar–O<sub>2</sub> никакой текстуры не наблюдалось [8,9]. С другой стороны, в работе [10], где использовалась подобная методика напыления Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, был показан рост пленок с текстурами (110), (100) и (111) в зависимости от доли кислорода в газовой смеси  $Ar-O_2$ . Появление текстуры в пленках Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> может быть связано с более высоким содержанием кислорода в смеси  $Ar-O_2$ .

В наших предыдущих работах [11,12] с использованием метода реактивного осаждения была продемонстрирована возможность роста пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> с текстурой (311) на поверхности SiO<sub>2</sub>/Si(001). Данная текстура сохранялась в температурном диапазоне роста (200–400°C). В этих экспериментах скорость осаждения Fe и давление кислорода были фиксированными: 0.8 nm/min и  $1.3 \cdot 10^{-6}$  Torr. В настоящей работе исследовано влияние давления кислорода на структурные свойства напыленных пленок.

# 2. Методика эксперимента

Эксперименты проводились на сверхвысоковакуумной установке "Катунь", оснащенной системами, позволяющими проводить диагностику методами дифракции быстрых электронов (ДБЭ) на отражение и спектральной эллипсометрии. Базовое давление не превышало  $10^{-10}$  Torr. В качестве подложек использовались монокристаллические пластины кремния размером  $0.5 \times 10 \times 20$  mm *n*-типа (удельное сопротивление 7.5  $\Omega \cdot$  cm) с ориентацией (001). До загрузки подложек в установку очистка их поверхности, а также формирование на ней слоя SiO<sub>2</sub> толщиной 1.5 nm проводились тем же способом, что и в работе [11]. После загрузки в вакуумную камеру образец прогревался при 500°C в течение часа.

Пленки магнетита толщиной 75 nm были выращены на поверхности SiO<sub>2</sub>/Si(001) путем реактивного осаждения Fe в атмосфере O<sub>2</sub> при температуре подложки 300°C. Осаждение Fe проводилось со скоростью 2.5 nm/min путем его термического испарения необходимого для формирования слоя магнетита толщиной 75 nm из ячейки Кнудсена с тиглем из оксида алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Количество осажденного Fe составляло приблизительно половину толщины слоя Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> — 37 nm. Парциальное давление кислорода варьировалось в диапазоне  $1 \cdot 10^{-6} - 5 \cdot 10^{-5}$  Torr. Картины ДБЭ были получены в процессе напыления пленок при углах скольжения электронного пучка к поверхности ~ 0.5–1°. После извлечения образцов из вакуумной камеры для анализа морфологии была использована атомно-силовая микроскопия (ACM).

# 3. Результаты и обсуждение

На начальной стадии осаждения Fe при низком давлении кислорода  $\sim 1 \cdot 10^{-6}$  Torr на картине ДБЭ (рис. 1, *a*) от поверхности SiO<sub>2</sub>/Si(001) видны кольца Дебая, характерные для поликристаллической пленки вюстита (FeO). Радиусы наиболее интенсивных колец согласуются с обратными значениями межплоскостных расстояний для отражений (111), (200) и (220) (обозначены вертикальными штрихами на рис. 1, а). При осаждении более чем половины толщины слоя Fe  $(d_{\text{Fe}} = 18.5 \,\text{nm})$  наблюдался переход к другой группе колец Дебая (рис. 1, b), которые сохранялись на картине ДБЭ до конца осаждения ( $d_{\rm Fe} = 37 \, {\rm nm}$ ). Положение этой группы колец хорошо согласуется с положением теоретических колец (вертикальные штрихи на рис. 1, b), рассчитанным для ГЦК-решетки магнетита со структурой инверсионной шпинели [13]. Равномерное распределение интенсивности вдоль колец указывает на случайную ориентацию кристаллитов Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> в пленке, а высокая резкость колец свидетельствует об их крупных размерах. Появление колец от Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> может объясняться как доокислением кристаллитов FeO, так и процессом диссоциации FeO на Fe и Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Так, в работе [14] отмечается, что FeO является нестабильным соединением при низком давлении и температуре менее чем ~ 570°С. Таким образом, присутствие некоторого количества железа в пленке оксида железа, выращенной нами при давлении  $\sim 1 \cdot 10^{-6}$  Torr, не может быть исключено. Как показано в работе [15], присутствие Fe может не проявляться в рентгеновском дифракционном спектре, в то время как месбауэровский спектр показывает наличие железа в пленке помимо Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

Во время осаждения Fe при более высоком давлении кислорода  $(3 \cdot 10^{-6}$  и  $7 \cdot 10^{-6}$  Torr) на картинах ДБЭ (рис. 2, *а* и *b*) наблюдались дуги, которые располагались вдоль линии колец Дебая, соответствующих магнетиту. Данные дуги наблюдались с самого начала и свидетельствуют о зарождении и росте кристаллитов с преимущественной ориентацией, т.е. текстурированной пленки [16]. Экспериментальная картина ДБЭ, полученная



**Рис. 1.** Картины ДБЭ, полученные после осаждения Fe в атмосфере кислорода при  $P = 1 \cdot 10^{-6}$  Torr: a — после осаждения половины слоя Fe ( $d_{\text{Fe}} = 18.5 \text{ nm}$ ), b — в конце осаждения ( $d_{\text{Fe}} = 37 \text{ nm}$ ).

от пленки, осаждавшейся при давлении  $P = 3 \cdot 10^{-6}$  Torr (рис. 2, a), согласуется с теоретической картиной для пленки с текстурой (311), рассчитанной в работе [11]. Ось данной текстуры совпадает с нормалью n к поверхности, а отражение (311) (в отличие от отражений другого порядка) располагается симметрично относительно нормали, образуя соответствующую дугу, как показано стрелкой на рис. 2, a. Измерение углового уширения  $\Delta \phi$ отражения (311) показывает, что отклонение оси [311] решетки кристаллитов от нормали **n** к поверхности варьируется в пределах ±15°. С другой стороны, было обнаружено, что осаждение железа при более высоком давлении кислорода (7 · 10<sup>-6</sup> Torr) приводит к формированию пленки с другим положением дифракционных дуг на картине ДБЭ (рис. 2, b). Их положение согласуется с положением дуг теоретической картины дифракции, рассчитанной для текстуры (110) в работе [17]. Ось текстуры (110), так же как и ось текстуры (311), параллельна нормали n. В связи с этим дифракционные дуги (220) и (440) располагаться симметрично относительно нормали (отмечены стрелками на рис. 2, b). В случае текстуры (110) угловое уширение ( $\Delta \phi$ ) рефлексов (220) и (440) относительно нормали **n** к поверхности составляет  $\sim \pm 20^{\circ}$ . Было замечено, что значение  $\Delta \phi$  для этой текстуры уменьшалось с увеличением давления кислорода при реактивном осаждении Fe, что свидетельствует



**Рис. 2.** Картины ДБЭ, полученные после осаждения слоя Fe толщиной 37 nm при давлении кислорода  $3 \cdot 10^{-6}$  (*a*),  $7 \cdot 10^{-6}$  (*b*) и  $5 \cdot 10^{-5}$  Torr (*c*).

о более высоком упорядочении кристаллитов Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. При последующем увеличении давления кислорода до  $\sim 5 \cdot 10^{-5}$  Тогт помимо колец 220 и 440, характерных для пленки магнетита с текстурой (110), наблюдалось появление новой группы колец, которые отмечены на рис. 2, *с* стрелками, направленными слева направо. Анализ показал, что радиусы новых колец хорошо согласуются с обратными значениями межплоскостных расстояний  $1/d_{hkl}$  кристаллической решетки гематита  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Наиболее интенсивные кольца наблюдаются для брэгтовских отражений (012), (104), (024), (113) и (116). Недавно в работе [18] брэгтовские пики для соответствующих отражений также наблюдались на рентгеновском спектре от пленки гематита, полученной при более высоком давлении кислорода (7.5  $\cdot 10^{-4}$  Torr).

На рис. 3 показаны картины, полученные методом ACM, от поверхности пленки магнетита с текстурой (311) (рис. 3, *a*) и (110) (рис. 3, *b*). Из анализа данных ACM обнаружено, что средний латеральный размер кристаллитов для указанных выше пленок составляет  $\sim$  30 и 40 nm, соответственно. Больший размер кристаллитов в случае роста пленки с текстурой (110) свидетельствует о более высокой диффузионной подвижности адсорбата на поверхности роста. Таким образом, на основании данных ACM можно сделать вывод, что при увеличении парциального давления O<sub>2</sub> диффузионная подвижность адсорбата возрастает и наблюдается переход к текстуре (110).

В случае магнетронного распыления Fe в газовой смеси Ar-O<sub>2</sub> в работе [10] были также получены пленки магнетита с текстурой, которая изменялась в зависимости от парциального давления кислорода. Для данного



**Рис. 3.** АСМ-изображения поверхности пленок магнетита, выращенных при давлении кислорода  $3 \cdot 10^{-6}$  (*a*) и  $7 \cdot 10^{-6}$  Torr (*b*).

метода осаждения пленка Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> могла иметь текстуру (110) (как в настоящей работе) и текстуры (100) и (111) при увеличении давления кислорода. Интересно отметить тот факт, что изменение текстуры в полученных пленках с ростом давления сопровождалось увеличением размера кристаллитов, как и в нашей работе. Соответствующая эволюция текстуры пленки имела место при увеличении соотношения потоков  $F(O_2) : F(Ar)$  от 0.6 : 0.5 до 0.7 : 0.5 в смеси Ar–O<sub>2</sub>. Кроме того, в работе [19] было показано, что увеличение парциального давления кислорода при магнетронном распылении Fe ведет к развитию более совершенной текстуры (111) у пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

В работе [20] изменение текстуры с увеличением потока реактивного газа (по сравнению с потоком металла) предлагается объяснять усилением процесса диссоциации и хемосорбции ионизованных молекул газа на гранях кристаллитов с низкой потенциальной энергией. Данные грани характеризуются низкой диффузионной подвижностью молекул. Только после этого процесса адсорбированные атомы газа становятся центрами зародышеобразования и взаимодействуют с адатомами металла. Тогда как на гранях с высокой диффузионной подвижностью величина хемосорбции остается неизменной. В результате увеличения потока газа конкурентная мода роста становится более выраженной, а "выживают" только те кристаллиты, грани которых имеют низкую энергию. Поскольку для ГЦК-структуры, грани {111} кристаллов характеризуются более высокой потенциальной энергией, чем грани {100}, {110}, {311}, увеличение давления реактивного газа должно приводить к переходу от текстуры (111) к (100), (110), (311) соответственно.

Однако, как было показано выше, в случае роста магнетита увеличение давления кислорода ведет к росту пленок с более высокой потенциальной энергией, имеющих текстуру (111) в [10,19] и (110) в настоящей работе. Мы полагаем, что при реактивном осаждении Fe в атмосфере O2 рост пленки магнетита может иметь иной механизм, отличающийся от предложенного в работе [20]. Так, можно предположить, что адсорбированные молекулы О2, минуя стадию хемосорбции, взаимодействуют с адатомами Fe. В результате этого на поверхности роста образуются молекулы оксида железа FeO<sub>x</sub>, обладающие более высокой диффузионной подвижностью, чем у молекул кислорода. Изменение процесса взаимодействия Fe и O<sub>2</sub> в сторону образования на поверхности молекул FeO<sub>x</sub> должно, по всей видимости, приводить к изменению механизма роста пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Мы считаем, что при увеличении парциального давления кислорода образование молекул FeO<sub>x</sub> становится доминирующим, а рост пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> реализуется за счет коалесценции [21]. При таком росте грани кристаллов с наибольшей потенциальной энергией должны быть параллельны поверхности подложки, а ось текстуры параллельна соответствующим кристаллографическим направлениям. Рост пленок за счет коалесценции будет происходить благодаря преимущественному боковому

разрастанию той части кристаллитов Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, которая была ориентирована гранями с высокой потенциальной энергией параллельно поверхности подложки. Данный механизм роста характеризуется высокой диффузионной подвижностью адсорбата на соответствующих гранях и разрастанием кристаллитов за счет них. В случае магнетита грани с ориентацией (111) имеют наибольшую диффузионную подвижность.

Наше предположение о высокой подвижности соединений FeO<sub>x</sub> на поверхности роста может объяснять рост пленок только с текстурой (111) (независимо от типа подложки), полученных методом импульсного лазерного распыления (PLD) при температурах подложки 300-450°С [2,22]. Так, в работе [23] установлено, что при использовании метода PLD формирование кристаллических пленок магнетита определяется процессом миграции на поверхности роста соединений FeO<sub>x</sub> (Fe(II) и Fe(III)), осаждаемых из источника  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (или Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>). Образование соединений FeO<sub>r</sub> в лучае PLD возможно также и в связи с высоким содержанием ионов и атомов, находящихся в возбужденном состоянии в абляционной лазерной плазме. Присутствие текстуры (311) в пленках Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, выращенных методом PLD, наблюдалось в работах [6,22]. Ее появление может связываться с уменьшением диффузионной подвижности адсорбата вследствие низкой температуры подложки (150°С) [22] либо высокой скорости осаждения 1-2 nm/s [6].

В случае магнетронного распыления Fe в атмосфере  $Ar-O_2$  образование на поверхности источника Fe соединений FeO<sub>x</sub>, а также их распыление из источника при некоторых условиях возможно [24]. Однако анализ оптических спектров эмиссии распыляемого вещества как из источника Fe [19], так и из оксидов железа (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) [25] показывает присутствие только атомарного железа. С другой стороны, благодаря высокой химической активности ионизованных молекул O<sub>2</sub>, образование молекул FeO<sub>x</sub> может активно происходить и на поверхности роста. Возможно, образование соединений FeO<sub>x</sub> на поверхности, а также их довольно высокая диффузионная подвижность при температуре подложки 400°C, приводят к росту пленок с текстурой (111) независимо от типа подложки [4,26].

При напуске молекулярного кислорода, как в настоящей работе, молекулы  $O_2$  имеют низкую химическую активность, а также малое время жизни на поверхности роста. Мы полагаем, что при давлении  $3 \cdot 10^{-6}$  Torr рост магнетита реализуется за счет процесса диффузии адатомов металла (Fe) к местам хемосорбции молекул газа (кислорода) [20]. В данном случае наиболее вероятными местами диссоциации и хемосорбции  $O_2$ будут грани {311} кристаллитов, имеющие низкую диффузионную подвижность (низкую потенциальную энергию). Рост кристаллитов в направлении, нормальном плоскости (311), будет идти быстрее, что соответствует конкурентной моде роста. При увеличении давления кислорода до  $7 \cdot 10^{-6}$  Torr плотность адсорбированных молекул О2 на поверхности роста возрастает, что приводит к взаимодействию их с адатомами Fe и образованию молекул FeO<sub>x</sub>. Из-за высокой диффузионной подвижности молекул FeO<sub>x</sub> рост пленки происходит благодаря преимущественному боковому разрастанию той части кристаллитов Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, которая была ориентирована гранями {110} параллельно поверхности подложки. В результате этого рост пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> осуществляется за счет коалесценции кристаллитов, что приводит к возникновению текстуры (110). Мы считаем, что в случае магнетронного распыления [10] окисление адатомов Fe ионизованными молекулами кислорода и образование молекул FeO<sub>x</sub> происходят более интенсивно, а эволюция текстуры пленки с давлением имеет следующий характер:  $(110) \rightarrow (100) \rightarrow (111)$ . В нашей работе при дальнейшем увеличении давления кислорода до  $\sim 5 \cdot 10^{-5}$  Torr на поверхности роста наблюдается процесс образования α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Из рис. 3, b можно видеть (показано стрелками), что за счет бокового разрастания некоторых граней в центре кристаллитов (или участков поверхности) присутствуют углубления. Можно предположить, что данные грани для пленки с текстурой (110) соответствуют ориентации (111) решетки магнетита. В случае текстуры (110) грани {111} кристаллитов должны располагаться либо нормально к поверхности, либо под углом 35.3°. Анализ АСМ-изображения показал, что грани кристаллитов располагаются под углами, близкими к значению 35° либо близкими к нормали к поверхности. С учетом разориентации кристаллитов относительно нормали к поверхности (±20°) наблюдаемые грани вполне могут соответствовать плоскостям {111} ГЦК-решетки магнетита. Боковое разрастание граней {111} в результате более высокой диффузионной подвижности адсорбата на них будет приводить к образованию углублений на участках поверхности, ограниченных этими гранями.

### 4. Заключение

С использованием метода ДБЭ нами проведен анализ структурно-фазового состава тонких пленок магнетита, сформированных на поверхности SiO<sub>2</sub>/Si(001) в результате реактивного осаждения Fe в атмосфере O<sub>2</sub>. Установлено, что величина давления кислорода влияет как на механизм роста поликристаллических пленок Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, так и на ориентацию кристаллитов в них. Так, в случае недостаточно высокого давления О2 наблюдается образование кристаллитов FeO на начальной стадии роста пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Выращенная таким образом пленка Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> характеризуется случайной ориентацией кристаллитов в ней. При более высоких значениях давления О2 рост пленки Fe<sub>3</sub>O4 реализуется с самого начала, а кристаллиты имеют преимущественную ориентацию. Пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> имели текстуру (311) или (110), ось которой совпадала с нормалью к поверхности. Обнаружено, что с увеличением давления О<sub>2</sub> текстура (311)

сменяется на текстуру (110). Рост пленки Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> при высоком давлении O<sub>2</sub> приводит к образованию в ней кристаллитов гематита.

### Список литературы

- [1] Z. Zhang, S. Satpathy. Phys. Rev. B 44, 13 319 (1991).
- [2] S. Tiwari, R. Prakash, R.J. Choudhary, D.M. Phase. J. Phys. D 40, 4943 (2007).
- [3] M.L. Parames, J. Mariano, Z. Viskadourakis, N. Popovici, M.S. Rogalski, J. Giapintzakis, O. Conde. Appl. Surf. Sci. 252, 4610 (2006).
- [4] C. Boothman, A.M. Sanchez, S. van Dijken. J. Appl. Phys. 101, 123 903 (2007).
- [5] C. Park, Y. Peng, J-G. Zhu, D.E. Laughlin, R.M. White. J. Appl. Phys. 97, 10C303 (2005).
- [6] X. Wang, Y. Sui, J. Tang, C. Wang, X. Zhang, Z. Lu, Z. Liu, W. Su, X. Wei, R. Yu. Appl. Phys. Lett. 92, 012 122 (2008).
- [7] Z.L. Lu, M.X. Xu, M.Q. Zou, S. Wang, X.C. Liu, Y.B. Lin, J.P. Xu, Z.H. Lu, J.F. Wang, L.Y. Lv, F.M. Zhang, Y.W. Du. Appl. Phys. Lett. **91**, 102 508 (2007).
- [8] W.B. Mi, Hui Liu, Z.Q. Li, P. Wu, E.Y. Jiang, H.L. Bai. J. Phys. D: Appl.Phys. 39, 5109 (2006).
- [9] Y. Kim, M. Oliveria. J. Appl. Phys. 75, 431 (1994).
- [10] G. Zhang, C. Fan, L. Pan, F. Wang, P. Wu, H. Qiu, Y. Gu, Y. Zhang, J. Magn. Magn. Mater. 293, 737 (2005).
- [11] В.В. Балашев, В.В. Коробцов, Т.А. Писаренко, Л.А. Чеботкевич. ЖТФ 81, 10, 122 (2011).
- [12] В.А. Викулов, В.В. Балашев, Т.А. Писаренко, А.А. Димитриев, В.В. Коробцов. Письма в ЖТФ 38, 7, 73 (2012).
- [13] E.J.W. Verwey, E.L. Heilmann. J. Chem. Phys. 15, 174 (1947).
- [14] R.M. Cornell, U. Schwertmann. The iron oxides: structure, properties, reactions, occurrences and uses. Wiley-VCH, Weomjeim, N.Y. (1996). P. 34.
- [15] Y. Bando, S. Horio, T. Takada. Jap. J. Appl. Phys. 17, 1037 (1978).
- [16] F. Tang, T. Parker, G.-C. Wang, T.-M. Lu. J. Phys. D 40, 427 (2007).
- [17] T.A. Pisarenko, V.V. Korobtsov, V.A. Vikulov, A.A. Dimitriev, V.V. Balashev. Solid State Phenomena 213, 51 (2014).
- [18] M.-F.Al-Kuhaili, M. Saleem, S.M.A. Durrani. J. Alloys Compd. 521, 178 (2012).
- [19] C. Ortiz, G. Lim, M.M. Chen, G. Castillo. J. Mater. Res. 3, 344 (1988).
- [20] I. Petrov, P.B. Barna, L. Hultman, J.E. Greene. J. Vac. Sci. Technol. A 21, 117 (2003).
- [21] P.B. Barna, M. Adamik. In: Science and technology of thin films / Eds F.C. Matacotta, G. Ottaviani. World Scientific, Singapore. (1995). Pt. 1. P. 1–29.
- [22] X. Huang, J. Ding. J. Korean Phys. Soc. 62, 2228 (2013).
- [23] D. Yokoyama, K. Namiki, H. Fukasawa, J. Miyazaki, K. Nomura, Y. Yamada. J. Radioanal. Nucl. Chem. 272, 631 (2007).
- [24] J. Hrbek. Thin Solid Films 42, 185 (1977).
- [25] K. Hammoum, T.El Asri, A. Chahboune, H. Aouchiche, A. Kaddouri. Eur. Phys. J. D 61, 469 (2011).
- [26] S.M. Watts, K. Nakajima, S. van Dijken, J.M.D. Coey. J. Appl. Phys. 95, 7465 (2004).